

2017年4月号

特集：使えるナノ加工技術と光応用

電子線リソグラフィー、ナノインプリントなど、ナノサイズの加工技術は日々進歩しており、様々なナノ構造が容易に安価に大量生産できる日もそう遠くないと思わせるような状況が作られつつある。一方、プラズモニック光デバイス、メタマテリアル、プラズモニックメタサーフェスなど、波長よりも小さい構造を持つ人工物質を用いた光デバイスの研究も進んでおり、一部実用化されたものもある。本特集では、ナノ構造を持つ光デバイスに関する最新のトピックスを取り上げるとともに、これらの光デバイスの工業的な生産がかのうになるためのナノ加工技術の現状と将来展望を特集することにより、ナノ構造光デバイスの実用化への展望を探る。

No.	タイトル	執筆者
1	特集のポイント	
2	ナノインプリント技術	SCIVAX
3	文部科学省 ナノテクノロジー・プラットフォームの概要	東京大学
4	電子線リソグラフィーによるナノ加工技術	東京大学
5	EUVリソグラフィー	ギガフォトン
6	サブ波長構造光学素子	大阪府立大学

※特集予定は都合により変更になる場合があります。詳細は営業担当にお尋ねください。

発行日：2017年3月25日
 申込締切：2017年2月25日
 原稿締切：2017年2月28日